智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專訴字第85號

原　　告　凌嘉科技股份有限公司

法定代理人　陳連春
訴訟代理人　林芮如律師
　　周靜
被　　告　友威科技股份有限公司

法定代理人　李原吉
訴訟代理人　楊理安律師
　　胡峰賓律師
　　趙嘉文

　　吳俊億

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國110年9月27日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原告之訴及假執行聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

本件原告起訴時聲明為：1.被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國發明第TWI513840號專利（即「多層膜的量產方法」，下稱系爭發明專利）之物品；2.被告應回收並銷毀侵害系爭發明專利之物品及其製造原料及器具；3.被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第TWM499418號專利（下

稱系爭新型專利）之物品；4.被告應回收並銷毀侵害系爭新型專利之物品及其製造原料及器具；5.被告應給付原告新臺幣（下同）500萬元，及自起訴日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；6.前五項請求，原告願供擔保請准為假執行之宣告（本院卷一第15至16頁）。嗣於民國109年11月3日減縮前開金錢給付之利息起算日並更正假執行宣告範圍（本院卷一第386頁）；又於110年4月30日以民事準備三狀撤回原聲明3.4.項（即系爭新型專利之請求部分），並變更原聲明1.2.項如原告後開訴之聲明所示（本院卷二第313至314頁）。關於上開減縮及撤回部分業經被告同意（本院卷一第386頁、本院卷二第343頁），至於變更聲明部分，被告雖不同意，惟經核原告之主張乃本於被告所製造銷售機具有使用系爭發明專利方法之同一事實，且其原提出之證據資料亦得相互援用，應認基礎事實同一，亦不甚礙於被告之防禦及訴訟之終結，依民事訴訟法第255條第1項第2、7款規定，核無不合，均應予准許。至於原告變更假執行範圍部分，核屬更正法律上之陳述，非屬訴之變更追加，附此敘明。

貳、實體方面：

一、原告主張及聲明：

（一）原告為系爭發明專利「多層膜的量產方法」之專利權人，專利權期間自103年12月25日至123年12月24日止。又兩造均為104年ＯＯＯＯＯＯＯＯＯ股份有限公司（下稱ＯＯＯ公司）真空濺鍍設備之競標廠商。原告與ＯＯＯ公司持續洽談至104年5月下旬時，ＯＯＯ公司告知決定使用被告製造之「水平連續式濺鍍系統」作為測試機種（產品型號：0000000000，下稱系爭產品1），約於同年9、10月左右進廠，並於同年11月由被告提供產品簡報（原證3、原證7）予ＯＯＯ公司，原告從被告於其所提供產品銷售簡報（原證4）中，竟相互比較原告使用系爭發明專利之產品（產品型號：Linco C3350）與被告0000 00000000000型號產品（下稱系爭產品2，並與系爭產品1合稱為系爭產品）之

規格參數，被告更於該銷售簡報將ＯＯＯ公司列為其銷售實績，嗣經原告向本院聲請證據保全後，本院以109年度民專抗字第8號裁定准許並進行證據保全在案。

（二）從被告之產品簡報（原證3）揭露之內容、ＯＯＯ公司提供之系爭產品1規格書（原證8）、操作手冊簡報檔（本院秘保限閱卷一第95至128頁）及於本院109年度民專抗字第8號保全證據程序所獲取之機台照片、維修手冊等資料，經比對後可知被告所製造銷售之系爭產品1之結構及方法，已落入系爭發明專利請求項1至10項之文義或均等範圍；又從原告所取得被告系爭產品2之銷售簡報（原證4、10）、影片檔及截圖（原證11）、產品螢幕照片影片影本（原證12）、規格書（原證9）、產品設備螢幕錄影檔（原證20）等，經比對後，被告所製造銷售系爭產品2之結構及方法，亦已落入原告系爭專利請求項1至10項之文義及均等範圍（侵權比對詳如原告民事辯論意旨㈡狀第1至59頁所載，本院秘保限閱卷二第35至93頁）。則被告未得原告同意，已然侵害原告專利權。為此，依專利法第96條第1項、第3項及民法第184條第1項前段、第2項規定提起本件訴訟並請求判決如聲明1.2.所示，並依專利法第96條第2項、第97條第1項第2款及第179條規定請求判決如聲明3.所示金額之損害賠償。

（三）聲明（本院卷二第478頁）：

1.被告不得直接或間接、自行或使他人使用系爭發明專利方法、使用或設計或製造使用該專利方法之設備或物、亦不得使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該專利方法製成之物。

2.被告應回收並銷毀侵害系爭發明專利之物及從事侵害行為之設備及物。

3.被告應給付原告500萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

4.第三項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告答辯及聲明：

（一）原告未能舉證證明系爭產品1落入系爭發明專利之文義或均等範圍：

1.由於原告之系爭發明專利性質上屬於「方法發明」，故原告如欲主張系爭產品未經其同意而「實施」該發明，自應就被告究竟如何「使用」系爭發明專利所揭示之方法逐一具體說明，並應就被告究竟如何「使用」系爭發明專利所揭示之方法等事實，負客觀舉證責任。又依專利侵權判斷要點第3.2.2「文義讀取之判斷方式」指出：「若系爭專利之請求項的標的為方法，應就該方法之技術特徵與被控侵權對象對應之方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對」。惟查，原告未就系爭發明專利之方法發明與被控侵權對象對應之方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對，僅泛泛以物之發明之比對方式進行比對，且其比對內容有諸多謬誤之處，原告否認系爭產品有落入系爭發明專利請求項之文義或均等範圍。

2.原告固主張由系爭產品1之簡報（原證3、7）、本院保全證據程序所得照片、維修手冊等所揭露之技術特徵侵害其專利權。惟原證3產品簡報中並未明確表示該機台型號，且經比對可知，原證3產品簡報中內容實際上與保全證據所得系爭產品1照片所呈現者有所差異，斷無因此認定原證3產品簡報者即為系爭產品1；又本案保全證據所取得之產品保養手冊第12頁僅為靶材更換之作業流程，根本無從證明系爭機台實際運作之情形；再者，本院秘保限閱卷一內由ＯＯＯ公司所提供之操作手冊（第108頁），並無揭露複數載板，亦不能與產品保養手冊進行步驟之關聯比對。因此，原告所舉上開證據均無法證明系爭產品1符合系爭專利請求項要件之步驟、條件。

3.至原告主張本件證據偏在於被告，請求被告應提出系爭產品1之「操作手冊」及「電路圖」等文件供其技術比對，惟系爭產品1為被告提供予ＯＯＯ公司共同研究之測試機

台，並無正式操作手冊及電路圖。且被告針對系爭產品1所作成之相關文件均已隨同系爭產品1提供予ＯＯＯ公司，而於本院證據保全程序（109年度民專抗字第8號）時，ＯＯＯ公司亦已如實提供訂購單、維修手冊、Tool管路圖、專案報價單、規格書、防噴水外罩說明、機台維修示意圖等文件，自無刻意隱瞞操作手冊及電路圖之理。原告請求調查核屬摸索證明，不應准許。

4.況依前述文義讀取之判斷方式，系爭產品1並未落入系爭發明專利請求項1要件1F、1G之文義或均等範圍，同樣亦沒有落入系爭發明專利請求項2至10之文義範圍（本院卷二第79至88頁）。

5.此外，系爭產品1係因ＯＯＯ公司欲進行相關設備的實驗，遂徵詢被告無償提供相關製程設備進行測試，該設備因ＯＯＯ原研發團隊解散，而由另一研發團隊接手進行其他研究、實驗，因而至今尚未取回機台，且亦僅有該一台設備於ＯＯＯ公司廠房，並無其他在ＯＯＯ公司量產販售之事實，故依專利法第59條第1項第2款，系爭專利權效力不及於系爭產品1。

（二）原告未能舉證證明系爭產品2落入系爭發明專利之文義及均等範圍：

1.原告主張之侵權產品原僅限被告放置於ＯＯＯ公司之系爭產品1，並不包括系爭產品2，其遲至準備四狀始提出原證9、10、11、12及20等用以佐證系爭產品2有侵害系爭發明專利之新證據，不但係於本件訴訟言詞辯論擬終結之際始具狀提出，且原告並未釋明其非因重大過失不能在準備程序階段提出該項證據之緣由，自應適用民事訴訟法第276條規定之失權效果，始符平允。

2.退步言，從原證11及原證12影片檔或原告擷取之片段照片中，根本無法看出機台型號，無法證明所顯示者即為系爭產品2；即便原證11及12所顯示者為系爭產品2之機台（僅假設），從影片及照片上都可以明確看到其左上角顯示：

「異常發生」，顯見該機台並非處於正常鍍膜狀態，如何能證明該系爭產品2正在進行系爭發明專利之多層膜量產方法之操作？凡此種種，均未見原告說明，益證原告於本件訴訟終結之際始提出上揭新證據，係以拖延訴訟為考量。

3.原告固提出系爭產品2之產品簡報（原證4）主張系爭產品2侵害系爭發明專利，惟其迄今仍未舉出系爭產品2機台放置何處？操作機台之人為何人？如該產品係置於國外，自然無侵害原告於我國之專利權可能。況本件原告主張侵權產品應限於被告放置於ＯＯＯ公司ＯＯＯＯＯ廠之系爭產品1，原告未說明其提出系爭產品2之機台系列相關證據之目的？故系爭產品2應非屬本案審理範圍，明顯是原告意圖混淆並藉此延滯訴訟程序。

（三）被告於系爭發明專利申請日前即已實施專利，或至少已完成實施系爭發明專利之必須準備工作，符合專利法第59條第1項第3款本文之規定：

1.原告主張系爭發明專利之技術特徵，主要是利用該鍍膜生產線之依序輪流配置的緩衝區間與鍍膜區間，並配合該等載具同時進入相對應的各鍍膜區間內執行各道鍍膜程序時，可於各鍍膜區間之兩相鄰緩衝區間位移，使各鍍膜區間內同時執行各道鍍膜程序，以有效地利用各鍍膜區間並提高鍍膜生產線的利用率，進而提高產能。

2.然一般濺鍍設備系統原為模組化設計，各製程腔體原本即得依客製化需求為各種排列組合。被告曾透過從屬公司ＯＯ電子（ＯＯ）有限公司（下稱ＯＯ公司）於102年5月27日寄發電子郵件予客戶ＯＯ半導體（ＯＯ）有限公司（下稱ＯＯ公司），其中電子郵件之附件即包括被告In-line濺鍍機（型號：0000000000）之報價單(乙證3）及設備規格書（乙證4）。該規格書第6頁之腔體模組1～15配合第5頁所示之2.1設備全覽圖，即已出現「濺鍍緩衝腔體」及「濺鍍腔體」輪流配置之設計。除去最前面與最後面之入

料模組及出料模組之外，中間的真空腔體模組包括1至15個腔體，其中，第4、8、9、13為濺鍍緩衝腔體，第5、6、7、10、11、12為濺鍍腔體，其中可將連續設置的腔體5、6、7視為第一組濺鍍腔體，連續設置的腔體8、9視為一組濺鍍緩衝腔體，連續設置的腔體10、11、12視為第二組濺鍍腔體，亦即以腔體4、腔體8～9、腔體13為三組濺鍍緩衝腔體，並以腔體5～7、腔體10～12為兩組濺鍍腔體，完全等同於系爭發明專利「(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間」的技術特徵，而該「緩衝區間」與「鍍膜區間」輪流配置之設計，亦可見於被告最終修改完成「ＯＯ公司」濺鍍系統之整機配製圖中（乙證6），有103年1月14日電子郵件往返紀錄（乙證7）可證。足見被告於系爭發明專利申請日前即已有多次為客戶設計之機台規格中，明確列出如同系爭發明專利「n個鍍膜區間以及（n+1）個緩衝區間」之技術特徵，且該等機台同屬為鍍膜相關設備，可判斷在系爭發明專利申請日前已實施發明，或至少已完成必須之準備，符合專利法第59條第1項第3款本文要件，而為系爭發明專利權之效力所不及。

（四）系爭發明專利有應撤銷原因，原告自不得對被告主張權利：

依據附表所示之先前技術證據資料及其證據組合，可證明系爭發明專利僅是拼湊先前技術中之技術手段，而各技術特徵仍以其通常之方式作動，在功能上並未相互作用，以致組合後之技術效果僅為所有單一技術所產生之技術效果的總合者，應認定該組合發明能輕易完成，依專利法第22條第2項規定不具進步性，具有應撤銷之原因，自不得對被告主張權利。

（五）聲明：（本院卷二第441頁）

1.原告之訴及假執行聲請均駁回。

2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、雙方不爭執之事實（本院卷一第388頁）：

（一）原告為系爭發明專利之專利權人。

（二）被告為我國第TWI557837號「真空設備多載具同時多工處理製程」發明專利之專利權人，專利申請日為103年4月10日（如乙證1）。

（三）被告放置於ＯＯＯ公司ＯＯＯＯＯ廠之「水平連續式濺鍍系統」（即系爭產品1），係由被告製造。

四、本件爭點如下（本院卷二第266至267頁、第344頁）：

（一）系爭產品是否落入系爭發明專利請求項1至10之文義或均等範圍？

（二）如系爭產品落入系爭發明專利之範圍，被告得否依專利法第59條第1項第3款規定，主張先實施之抗辯？

（三）如系爭產品落入系爭發明專利之範圍，被告得否依專利法第59條第1項第2款規定，主張因研究或實驗為目的之行為，不受專利權效力所及？

（四）系爭發明專利是否有應撤銷之事由（被告主張無效之證據組合詳如附表所載）？

（五）原告請求排除侵害、損害賠償如聲明第一至三項，有無理由？

五、本院判斷：

（一）系爭發明專利技術分析：

1.系爭發明專利技術內容：

系爭專利為多層膜的量產方法，是令多數待鍍物進行多道鍍膜程序並依序包含：(a)提供具(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間及多個載具的鍍膜生產線，緩衝區間與鍍膜區間沿一排列方向輪流設於一真空腔體內；(b)於第一個緩衝區間載入置有第一個待鍍物的第一個載具；(c)令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序時是於第一、二個緩衝區間位移數次；(d)令第一個載具位於第二個緩衝區間且同時於第一個緩衝區間載入置有第二個待鍍物的第二個載具；及(e)同時令第二與第一個載具於第一與第二個鍍膜區間執行第一與第二道鍍膜程序時是各於第一、

二個與第二、三個緩衝區間位移數次（參系爭專利摘要）。

2.系爭發明專利主要圖式：詳如附圖1所示。

3.系爭發明專利申請專利範圍分析：

系爭發明專利請求項共10項，其中請求項1為獨立項，請求項2至10為直接或間接依附於請求項1之附屬項。原告主張被告侵害之請求項1至10，內容如下：

⑴一種多層膜的量產方法，是用以將多數待鍍物進行多道鍍膜程序，其包含以下步驟：

一步驟(a)，提供一具有(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置於一真空腔體內，n≧2且是正整數；

一步驟(b)，於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍物的第一個載具；

一步驟(c)，於該步驟(b)後，令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序以於第一個待鍍物上形成一第一膜層時，是於該第一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；

一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間；及

一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有條件的

是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間。

⑵如請求項1所述的多層膜的量產方法，還包含一步驟(f)及一步驟(g)，且n=3，其中，

該步驟(f)，於該步驟(e)後，令第一個載具位於第三個緩衝區間或第四個緩衝區間，且同時令第二個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，並同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第三個待鍍物的第三個載具，但有條件的是，當第三個載具位於第二個緩衝區間時，第二個載具是位於第三個緩衝區間，且第一個載具是位於第四個緩衝區間；

及該步驟(g)，於該步驟(f)後，同時令第三個載具、第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間、第二個鍍膜區間與第三個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序、第二道鍍膜程序與第三道鍍膜程序，以分別於第三個待鍍物上、第二個待鍍物之上與第一個待鍍物之上形成該第一膜層、該第二膜層與一第三層膜時，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間、第二、三個緩衝區間兩者間與第三、四個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第三個載具位於第二個緩衝區間時，第二個載具是位於第三個緩衝區間且第一個載具是位於第四個緩衝區間。

⑶如請求項2所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(b)是於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間載入放置有第一個待鍍物的第一個載具；該步驟(d)是令第一個載具位於第二個緩衝區間，且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載具。

⑷如請求項3所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(f)是令第一個載具位於第三個緩衝區間，且同時令第二個載具位於第二個緩衝區間，並同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間載入放置有第三個待鍍物的第三個載具。

⑸如請求項1所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(e)之第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序時所耗費的時間相同。

⑹如請求項5所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(e)之第二個載具與第一個載具，分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間所位移的次數相同，且所位移的速率相同。

⑺如請求項2所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(g)之第三個載具、第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間、第二個鍍膜區間與第三個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序、第二道鍍膜程序與第三道鍍膜程序時所耗費的時間相同。

⑻如請求項7所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(g)之第三個載具、第二個載具與第一個載具，分別於第一、二個緩衝區間兩者間、第二、三個緩衝區間兩者與第三、四個緩衝區間兩者間所位移的次數相同，且所位移的速率相同。

⑼如請求項1至8任一請求項所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(a)之每一個鍍膜區間包括至少一鍍膜段，且該等鍍膜段是分別以一靶材來執行各鍍膜程序，該等靶材是由不同材質所構成或由相同材質所構成。

⑽如請求項1至8任一請求項所述的多層膜的量產方法，其中，該步驟(a)之該鍍膜生產線還具有一分別設置於該真空腔體之相反兩端的一入口閥門、一出口閥門、一連續地設置於該等緩衝區間和該等鍍膜區間內用以傳輸該等載具的傳輸機構，及一供該等載具自該出口閥門回流至該入口閥門的自動回流單元，該自動回流單元包括一銜接該出口閥門的載出腔、一銜接該入口閥門的載入腔，及一銜接於該載出腔與該載入腔之間的回送機構，該回送機構具有一對應載出腔設置的沉降段、一對應該

載入腔設置的舉升段，及一連接該沉降段與該舉升段的中繼段。

（二）系爭產品1所使用方法並未落入系爭發明專利請求項1至10項之文義及均等範圍：

1.系爭專利請求項1之技術內容可拆解為7個要件，分別如下：

要件編號1A：「一種多層膜的量產方法」；

要件編號1B：「是用以將多數待鍍物進行多道鍍膜程序，其包含以下步驟：」；

要件編號1C：「一步驟(a)，提供一具有(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置於一真空腔體內，n≧2且是正整數；」

要件編號1D：「一步驟(b)，於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍物的第一個載具；」

要件編號1E：「一步驟(c)，於該步驟(b)後，令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序以於第一個待鍍物上形成一第一膜層時，是於該第一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；」

要件編號1F：「一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間；」

要件編號1G：「及一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區

間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間。」

2.系爭產品1之技術內容（如附圖2）：

經核原證3之系爭產品1簡報第15頁之設備圖與0000000000產品保養手冊第12頁第3張圖、保全證據照片IMG_00000000_161819設備顯示照片、操作手冊簡報第12頁(本院秘保限閱卷一第108頁)相同，應為同一產品之介紹，故本院自得以上開證據資料作為分析系爭產品1之技術特徵，先予敘明。

3.系爭產品1並未落入系爭發明專利請求項1之文義範圍：

茲就系爭產品1與系爭發明專利請求項1之各技術特徵進行比對說明如下：

⑴要件編號1A：（符合）

依系爭產品1規格書（原證8，本院秘保限閱卷一第261至274頁）第5頁記載「ＯＯＯ

空腔體模組】欄位記載「00ＯＯＯ 00」、第6頁【1.5產品規格】記載「產品鍍膜厚度：ＯＯＯ000000Ｏ0000ＯＯＯ00000」及原證3第16頁濺鍍流程圖「000000000 0000000 00 0000000 0000000 000000000 0000000」。可知系爭產品1具有0個濺鍍腔，可將複數個客戶的 Jedec tray進行複數個濺鍍程序，故系爭產品1可為系爭發明專利請求項1要件編號1B「是用以將多數待鍍物進行多道鍍膜程序，其包含以下步驟：」所文義讀取。

⑶要件編號1C：（符合）

依系爭產品1規格書第7頁【2.1真空腔體模組】型式欄位記載「ＯＯＯＯＯＯＯ」、設備模組欄位記載「00ＯＯＯＯＯ00 00ＯＯＯ00」、【2.2載具】載盤數欄位記載「00組(含備品)」、第4頁系統配置圖。可知系爭產品1之真空腔體模組具有0個濺鍍腔(即n=0)、0個緩衝腔及00個載具，且依系統配置圖緩衝腔與濺鍍腔是以直線排列方向輪流設置，故系爭產品1可為系爭發明專利請求項1要件編號1C「一步驟(a)，提供一具有(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置於一真空腔體內，n≧2且是正整數；」所文義讀取。

⑷要件編號1D：（符合）

依原證3第15、16頁之設備構造圖及濺鍍流程圖，可知承載待鍍物之載具，自Load Area起至Unload Area必先進入CHB31緩衝腔，故系爭產品1可為系爭發明專利請求項1要件編號1D「一步驟(b)，於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍物的第一個載具；」所文義讀取。

⑸要件編號1E：（符合）

依系爭產品1規格書第5頁【設備零件表】欄位記載「CHB32：0000000 00」，原證3第15頁之設備構造圖，CHB32具有0支陰極，為濺鍍腔，CHB31及CHB33為緩衝腔，原

證3第16頁之濺鍍流程圖，當製程進入「000000000 0000000」時載具位置係由CHB31傳至CHB33，即在此程序中載具在CHB31及CHB33兩者間位移至少一次，故系爭產品1可為系爭發明專利請求項1要件編號1E「一步驟(c)，於該步驟(b)後，令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序以於第一個待鍍物上形成一第一膜層時，是於該第一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；」所文義讀取。

⑹要件編號1F：（不符合）

依原證3第15頁之設備圖、0000000000產品保養手冊第12頁第3張圖、保全證據照片IMG_00000000_161819設備顯示照片、操作手冊簡報第12頁(本院秘保限閱卷一第108頁)，可知濺鍍腔與緩衝腔雖可容納複數載盤，惟未揭示當第一個載具位於第二個緩衝腔CHB33或第三個緩衝腔CHB35時，第二個載具係「同時」位於該鍍膜生產線的第一個緩衝腔CHB31或第二個緩衝腔CHB33，故系爭產品1未為系爭專發明利請求項1要件編號1F「一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」所文義讀取。

⑺要件編號1G：（不符合）

依操作手冊簡報第12頁設備傳輸控制所載「內部傳輸控制：ＯＯＯ000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ000000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ…」（本院秘保限閱卷一第108頁），可知系爭產品1可控制各腔室傳輸之正轉、反轉、定位與工作速度等；又系爭產品1規格書第5頁【設備零件表】欄位記載「CHB32：0000000 00」、「CHB34：000000000」，且由原證3第15頁之設備圖及第16頁

濺鍍流程圖，濺鍍腔與緩衝腔雖可容納複數載盤，且第二個待鍍物於濺鍍腔CHB32形成該第一膜層與第一個待鍍物於濺鍍腔CHB34形成一第二膜層時，可分別於第一、二個緩衝腔(CHB31、CHB33)兩者間與第二、三個緩衝腔(CHB33、CHB35)兩者間位移至少一次，惟未揭示系爭產品1之鍍膜程序係「同時」令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜腔CHB32與第二個鍍膜腔(CHB34)內執行鍍膜程序，且第二個載具與第一個載具同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，故系爭產品1未為系爭發明專利請求項1要件編號1G「及一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」所文義讀取。

⑻綜上，由於系爭產品1欠缺系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之技術特徵，依全要件原則，系爭發明專利請求項1並未文義讀取系爭產品1，故不構成文義侵權。

4.又系爭發明專利請求項2至10，均係直接或間接依附於請求項1，為請求項1權利範圍之進一步限縮，因系爭產品1未落入系爭發明專利請求項1之專利權範圍，已如前述，故系爭產品1當然未落入系爭發明專利請求項2至10之專利權範圍。

5.原告主張不可採之論駁：

⑴原告主張依原證3第15至16頁之設備構造圖及濺鍍流程圖、0000000000產品保養手冊第12頁第3張圖、保全證據照片IMG_00000000_161819設備顯示照片、操作手冊

簡報第12頁設備傳輸控制，均揭示標記為黃色之2個載盤已分別同時載入第2個濺鍍緩衝區間CHB33及第1個濺鍍緩衝區間CHB31，複數個黃色標記之待鍍物自Load Area起至Unload Area，必然先後進入第一濺鍍緩衝腔CHB31、第二濺鍍緩衝腔CHB33、第三濺鍍緩衝腔CHB35，可知第一個放置待鍍物之載盤位於第二濺鍍緩衝腔CHB33，第二個放置待鍍物之載盤即同時位於第一濺鍍緩衝腔CHB31等等(本院秘保限閱卷一第20頁、第214至215頁)。惟查：依0000000000產品保養手冊第12頁第3張圖，係於系統停機執行靶材更換之作業流程，畫面左上角顯示「自動作業停止」訊息，並非處於鍍膜生產程序之狀態（本院秘保限閱卷一第403至404頁），若依原告所稱標記黃色為載盤，則圖中全部腔室均亮起黃色標記代表全部腔室內均有載盤，尚不足以證明「第一個載具位於第二個緩衝腔CHB33或第三個腔CHB35時，第二個載具係同時位於該鍍膜生產線的第一個緩衝腔CHB31或第二個緩衝腔CHB33」；又操作手冊第12頁(本院秘保限閱卷一第108頁)設備傳輸控制及保全證據照片IMG_00000000_161819設備，畫面左上角揭示「自動作業停止」，且圖中未顯示任何載入待鍍物載盤之黃色標記，亦無法說明第1、2個載具與緩衝區間之關係。而原證3第15頁僅揭示第一載具位於真空腔體CHB22，第二載具位於載入區域Load Area，而在第一載具前進至第二濺鍍緩衝腔CHB33或第三濺鍍緩衝腔CHB35時，仍無法確定第二載具「同時」位於第一濺鍍緩衝腔CHB31或第二濺鍍緩衝腔CHB33，例如當第一載具第二濺鍍緩衝腔CHB33時，第二載具可能位於CHB1、CHB21、CHB22、CHB31、CHB32或仍在Load Area，並無法得知第二載具如要件編號1F所界定位於第一濺鍍緩衝腔CHB31，且操作手冊第12頁(本院秘保限閱卷一第108頁)設備傳輸控制所載「內部傳輸控制：ＯＯＯ000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ000000Ｏ

ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ…」，亦僅能說明系爭產品1可對各腔室之傳輸部件進行正轉、反轉、定位與工作速度等控制動作，核與系爭發明專利要件編號1F並無必然關係，故原告上開主張尚不足採。

⑵原告又主張依原證3第15至16頁之設備構造圖及濺鍍流程圖，揭示系爭產品1為連續式、直線、間隔排列濺鍍緩衝腔及濺鍍腔之設計，第二個放置待鍍物之載盤自第一濺鍍緩衝腔CHB31，進入第一濺鍍腔CHB32執行第一道鍍膜程序，以於待鍍物上形成第一層膜，必然於第一濺鍍緩衝腔CHB31及第二濺鍍緩衝腔CHB33之間移動至少一次；同時，第一個放置待鍍物之載盤自第二濺鍍緩衝腔CHB33，進入第二濺鍍腔CHB34執行第二道鍍膜程序，以於待鍍物上形成第二層膜，必然於第二濺鍍緩衝腔CHB33及第三濺鍍緩衝腔CHB35之間移動至少一次等等(本院秘保限閱卷一第21至22頁)。惟查：依原證3第15至16頁僅能得知系爭產品1具有三個濺鍍腔CHB32、CHB34、CHB36，且載具可進行多道濺鍍製程，然並無法得知第二個載具在第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序時，第一個載具同時位於第二個鍍膜區間執行第二道鍍膜程序，或同時分別於第一、二個濺鍍緩衝腔兩者間與第二、三個濺鍍緩衝腔兩者間位移至少一次，亦無法得知當第二個載具位於第二濺鍍緩衝腔CHB33時，第一個載具是位於第三濺鍍緩衝腔CHB35，其可能仍位於第二濺鍍腔CHB34或已前進至第三濺鍍腔CHB36；又操作手冊第12頁(本院秘保限閱卷一第108頁)設備傳輸控制所載「內部傳輸控制：ＯＯＯ000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ000000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ…」內容，亦僅能說明系爭產品1可對各腔室之傳輸部件進行正轉、反轉、定位與工作速度等控制動作，並不必然可推論系爭發明專利要件編號1G之載具和緩衝區間之關係，故原告主張並不足採。

6.系爭產品1亦未落入系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之均等範圍：

⑴原告雖主張系爭產品1縱欠缺系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之技術特徵，然依原證11即0000 0000000000型號產品簡報及原證20影片檔（本院秘保限閱卷一第317至339頁、第483頁），顯示二黃色載盤分別同時載入第一濺鍍緩衝腔CHB31及第三濺鍍緩衝腔CHB35，第一黃色載盤位於鍍緩衝腔CHB35，同時第二黃色載盤位於濺鍍緩衝腔CHB33，其手段方法、功能、結果與系爭發明專利請求項1要件編號1F本質並無差異；又系爭產品1之二載盤同步往復鍍膜手段方法，與系爭發明專利請求項1要件編號1G之本質上亦無差異，所欲執行之功能無非係供二載盤同時進行濺鍍程序中之緩衝降溫階段，並待降溫完畢後同時接續進入緊鄰之濺鍍腔繼續濺鍍程序之密接循環，均產生相同之避免濺鍍過熱停機與增進產能之效果，故二者為均等，已落入系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之均等範圍。

⑵惟查，觀諸原告所提原證11即0000 00000000000型號產品簡報及原證20影片檔，畫面並無機台型號（僅有UVAT），並無法得知其即為系爭產品1之螢幕畫面。況且依其畫面左上角顯示有「異常發生」紅字，顯非處於正常運作狀態中，自難作為認定系爭產品1有落入系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G均等範圍之證據。是以，原告主張系爭產品1有落入系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之均等範圍，即屬無據。

（三）系爭產品2並未落入系爭發明專利之文義及均等範圍：

原告固提出原證9至12及原證20用以證明系爭產品2係使用系爭發明專利之方法而落入系爭發明專利請求項1之文義及均等範圍。惟觀諸原告所提原證11、12及原證20之影片或照片所顯示之機台控制介面，右上角僅有被告公司之標誌「UVAT」，並無機台型號可證明其確為系爭產品2（000

0000 0000）之機台畫面，自無法與原證9、10相互勾稽，自應予排除，故本院以下僅就原證9、10與系爭產品2為侵權比對，核先敘明。

1.系爭產品2與系爭發明專利請求項1之技術特徵比對說明：

⑴要件編號1A：（符合）

依原證9即系爭產品2規格書第6頁【1.3設備介紹】記載「本公司所研發製造之連續式真空濺鍍機，ＯＯＯ

置圖緩衝腔與濺鍍腔是以直線排列方向輪流設置，故系爭產品2可為系爭發明專利請求項1要件編號1C「一步驟(a)，提供一具有(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置於一真空腔體內，n≧2且是正整數；」所文義讀取。

⑷要件編號1D、1E：（符合）

依原證10第8頁記載「0 00000000 0000 000 000000 0000 00 0000000000 0000」、「0000000 00000 000000000」，可知系爭產品2之載盤係由最左方之Heating腔體依序經過第一濺鍍緩衝腔CHB31、第一濺鍍腔CHB32…至CHB4等，必先進入CHB31第一緩衝腔，且可於濺鍍沉積區中來回往復移動，故系爭產品2可為系爭發明專利請求項1要件編號1D「一步驟(b)，於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍物的第一個載具；」及要件編號1E「一步驟(c)，於該步驟(b)後，令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序以於第一個待鍍物上形成一第一膜層時，是於該第一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；」所文義讀取。

⑸要件編號1F：（不符合）

依原證10第8頁記載「0 00000000 0000 000 000000 0000 00 0000000000 0000」、「0000000 00000 000000000」，原告雖主張「系爭產品2係由最左方之Heating腔體，依序經過第一濺鍍緩衝腔CHB31、第一濺鍍腔CHB32、第二濺鍍緩衝腔CHB33等區間，且系爭產品2係同時供五個載盤分別於濺鍍生產線上之CHB31~CHB33、CHB33~CHB35、CHB35~CHB37、CHB37~CHB39及CHB39~CHB311五個區段同時往復移動，為避免各載盤壅塞至同一腔體造成碰撞，系爭產品2必然產生五載盤同時分別位於濺鍍緩衝腔CHB31、CHB33、CHB35、CHB37及CHB39

之結果」等等，惟由原證10第8頁僅能說明系爭產品2之5個載盤可於濺鍍沉積區中來回往復移動，並不足以證明在第一個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間時，第二個載具「同時」位於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間，亦不能證明當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間之條件，因此系爭產品2未為系爭發明專利請求項1要件編號1F「一步驟(d)，於該步驟(c)後，令第一個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」所文義讀取。

⑹要件編號1G：（不符合）

依原證9第5頁【1.2設備零件表】欄位記載「CHB32：000000000」、「CHB34：000000000」，原證10第8頁記載「0 00000000 0000 000 00000 0000 00 0000000000 0000」、「0000000 0000 000000000」，原告雖主張「該簡報更揭示其中二載盤之移動方式為『ＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯＯＯ00000』以及『ＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ00000ＯＯＯＯＯＯＯＯ00000』，已揭示系爭產品2同時自第一濺鍍緩衝腔CHB31至第二濺鍍緩衝腔CHB33之間，及自第二濺鍍緩衝腔CHB33至第三濺鍍緩衝腔CHB35之間」等等，惟由原證10第8頁僅能說明系爭產品2之5個載盤可於濺鍍沉積區中來回往復移動，並不足以證明第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內「同時」執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序、且「同時」分別於第

一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，亦不能證明當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間之條件，故系爭產品2未為系爭發明專利請求項1要件編號1G「及一步驟(e)，於該步驟(d)後，同時令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」所文義讀取。

⑺綜上，系爭產品2欠缺系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之技術特徵，依全要件原則，系爭發明專利請求項1並未文義讀取系爭產品2，故系爭產品2不構成文義侵權。

2.又系爭發明專利請求項2至10係直接或間接依附於請求項1，為請求項1權利範圍之進一步限縮，因系爭產品2未落入系爭發明專利請求項1之文義範圍，已如前述，故系爭產品2當然未落入系爭發明專利請求項2至10之專利權範圍。

3.至於原告雖以原證11、12及原證20主張系爭產品2落入系爭發明專利要件編號1F、1G之均等範圍，惟原證11、12及原證20之圖片或影片中並無機台型號可證明其為系爭產品2，已如前述，因此原告仍未能證明系爭產品2有落入系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之均等範圍。

4.基上，由於系爭產品2欠缺系爭發明專利請求項1之技術特徵1F、1G，基於全要件原則，系爭產品2並未落入系爭發明專利請求項1至10之文義範圍。又原告亦未能舉證證明系爭產品2有落入系爭發明專利請求項1要件編號1F、1G之

均等範圍，故原告主張系爭產品2落入系爭發明專利之文義及均等範圍，均不足採。

（四）此外，本件因系爭產品並未落入原告主張系爭發明專利請求項1之文義或均等範圍，原告主張被告有侵害系爭發明專利之事實，即屬無據，故本件其餘爭點【即㈡被告得否依專利法第59條第1項第3款規定，主張先實施之抗辯？㈢被告得否依專利法第59條第1項第2款規定，主張因研究或實驗為目的之行為，不受發明專利權之效力所及？㈣系爭專利是否有應撤銷之事由？】即無審究之必要。

六、綜上所述，本件被告製造之系爭產品並未落入原告所主張系爭發明專利請求項1至10之文義及均等範圍，故系爭產品不構成侵害系爭發明專利。從而，原告依專利法第96條第1至3項、第97條第1項第2款及民法第184條第1項前段、第2項規定，訴請被告負損害賠償責任、防止及排除侵害，並銷毀侵害系爭發明專利之產品及用以製造之原料及器具，均屬無據，另原告依民法第179條規定，請求被告返還不當得利所獲之所有利益，因系爭產品並未侵害原告系爭發明專利，亦難認有據，均應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行聲請亦失所附麗，應併予駁回之。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

八、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　10　　月　　19　　日

智慧財產第二庭

法　官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　10　　月　　28　　日

書記官　蔣淑君